令和元年度 集積回路設計技術·次世代集積回路工学特論資料

低/中間周波動作

群馬大学 松田順一

1

概要

- ・低周波小信号モデル
 - チャネルパスの小信号モデル
 - ドレイン~基板パスの小信号モデル
 - ・ 強反転領域でのコンダクタンス
 - 弱反転領域でのコンダクタンス
- 中間周波小信号モデル
 - ・ 真性部分の各容量(強反転と弱反転)
- 外部領域の小信号モデル
- ・ノイズモデル
- 付録
 - ・ ゲート・フリンジ容量導出
- (注)以下の本を参考に、本資料を作成。
- (1) Yannis Tsividis, Operation and Modeling of the MOS Transistor Second Edition, McGraw-Hill, New York, 1999.
- (2) Yannis Tsividis and Colin McAndrew, Operation and Modeling of the MOS Transistor Third Edition, Oxford University Press, New York, 2011.



MOSトランジスタへのdc電圧印加と小信号変化



V_{GS}, V_{BS}, V_{DS} の小信号変化の合成



小信号変化による電流:∆/_{DS}

V_{GS},V_{BS},V_{DS}の小信号変化による電流





小信号変化による電流:△/_{DB}

V_{GB},V_{SB},V_{DB}の小信号変化による電流



低周波小信号等価回路(チャネル電流と基板電流)



ゲート・トランス・コンダクタンス(強反転)

ゲート・トランス・コンダクタンスは、長チャネル・デバイスの場合、

$$I_{DS} = \frac{W}{L} \mu C_{ox} \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{\alpha}{2} V_{DS}^2 \right]$$

$$V_{DS} = \frac{V_{GS} - V_T}{\alpha}$$

速度飽和がある場合、 $g_m \approx WC'_{ox}\mu E_c$ $\approx WC'_{ox}|v_d|_{max}$ となる。 $I'_{DS} \approx WC'_{ox}(V_{GS} - V_T)\mu E_c$

基板トランス・コンダクタンス1(強反転)

完全対称強反転モデル

$$I_{DS} = \frac{W}{L} \mu C_{ox}^{'} \left\{ (V_{GB} - V_{FB} - \phi_0) (V_{DB} - V_{SB}) - \frac{1}{2} (V_{DB}^2 - V_{SB}^2) - \frac{1}{2} (V_{DB}^2 - V_{SB}^2) - \frac{2}{3} \gamma \left[(\phi_0 + V_{DB})^{3/2} - (\phi_0 + V_{SB})^{3/2} \right] \right\}$$

を使って、 g_{mb} は $g_{mb} = \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{BS}}\Big|_{V_{GS}, V_{DS}} = \begin{cases} \left(\frac{\gamma}{\sqrt{V_{DS} + V_{SB} + \phi_0} + \sqrt{V_{SB} + \phi_0}}\right)g_m & V_{DS} \leq V_{DS} \\ \left(\frac{\gamma}{\sqrt{V_{DS} + V_{SB} + \phi_0} + \sqrt{V_{SB} + \phi_0}}\right)g_m & V_{DS} > V_{DS} \\ \frac{\gamma}{\sqrt{V_{DS} + V_{SB} + \phi_0} + \sqrt{V_{SB} + \phi_0}} g_m & V_{DS} > V_{DS} \end{cases}$ となる。ここで、 $V_{DB} = V_{DS} + V_{SB}, V_{GB} = V_{GS} + V_{SB}, V_{SB} = -V_{BS} \ge \cup \top @ \% \ DS \rightarrow C_{DS} \end{cases}$

基板トランス・コンダクタンス2(強反転)

 V_{DS} が小さい場合、また V_{GS} が小さい (V_{DS} も小さい) 場合、

$$\frac{g_{mb}}{g_m} \approx \frac{\gamma}{2\sqrt{V_{SB} + \phi_0}} = \frac{dV_T}{dV_{SB}} = \alpha_1 - 1 \approx n - 1$$

$$\geq \beta_S \mathcal{Z}_{\circ} \quad \zeta \subset \mathcal{T}_{\circ}$$

$$V_{T} = V_{FB} + \phi_{0} + \gamma \sqrt{\phi_{0} + V_{SB}}, \quad \alpha_{1} = 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{\phi_{0} + V_{SB}}}, \quad n = 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_{F} + V_{SB}}}$$

である。また、 g_{mb}/g_m は、

 $\frac{g_{mb}}{g_m} \approx \frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_{ox}} \frac{t_{ox}}{d_{Bm}}$ となる。 d_{Bm} は空乏層深さである。

$$\gamma = \frac{\sqrt{2q\varepsilon_s N_A}}{C_{ox}}$$
$$d_{Bm} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{qN_A}} \sqrt{\phi_0 + V_{SB}}$$

 $g_m \ge g_m$ の関係



ソース・ドレイン・コンダクタンス1(強反転)

完全対称強反転モデル(非飽和領域)

 $I_{DS} = \frac{W}{L} \mu C_{ox} \left\{ \left(V_{GB} - V_{FB} - \phi_0 \right) \left(V_{DB} - V_{SB} \right) - \frac{1}{2} \left(V_{DB}^2 - V_{SB}^2 \right) - \frac{2}{3} \gamma \left[\left(\phi_0 + V_{DB} \right)^{\frac{3}{2}} - \left(\phi_0 + V_{SB} \right)^{\frac{3}{2}} \right] \right\}$ を使って、 g_{sl} は以下の如くになる。 $(V_{DB} = V_{DS} + V_{SB})$ $g_{sd} = \frac{W}{I} \mu C'_{ox} \left(V_{GS} - V_{DS} - V_{FB} - \phi_0 - \gamma \sqrt{V_{DS} + V_{SB} + \phi_0} \right) \qquad V_{DS} \le V'_{DS}$ また、簡単化されたソース参照強反転モデル(非飽和領域) $I_{DS} = \frac{W}{I} \mu C_{ox} \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{\alpha}{2} V_{DS}^2 \right]$ を使うと、 g_{u} は以下になり、この g_{u} は $V_{DS} = 0$ で上記 g_{u} に等しくなる。 $g_{sd} = \frac{W}{I} \mu C_{ox} (V_{GS} - V_T - \alpha V_{DS}) \qquad V_{DS} \le V_{DS}$

ソース・ドレイン・コンダクタンス2(強反転)

飽和領域での g_{sd} を求める。(CLMとDIBLを考慮)CLMの場合、 I_{DS} は、



ソース・ドレイン・コンダクタンス3(強反転)

1,が以下の場合、 $l_{p} = l_{a} \ln \left| 1 + \frac{V_{DS} - V_{DS}}{V_{E}} \right| \qquad (\mathbb{E} \cup \mathbb{V}_{a} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{s}}{\varepsilon_{m}}} t_{ox} d_{j} \approx \sqrt{3t_{ox}} d_{j}$ g_{sd} $g_{sd} = \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{DS}} \approx I_{DS} \frac{1}{L} \frac{\partial l_p}{\partial V_{-1}}$ $I_{DS} = I_{DS}' \left(1 + \frac{V_{DS} - V_{DS}'}{V_{.}} \right)$ $=\frac{l_{a}}{L}\frac{I_{DS}}{V_{a}+(V_{DG}-V_{DG})}=\frac{I_{DS}}{V_{a}(V_{DG})}$ $g_{sd} \approx \frac{I_{DS}}{V_{.}} \quad V_{DS} > V_{DS}$ 但し、 $V_A(V_{DS}) = \frac{L}{l} \left[V_E + \left(V_{DS} - V_{DS} \right) \right]$

17

ソース・ドレイン・コンダクタンス4(強反転)

DIBLの場合、 I_{DS} を以下の如くとすると、

$$I_{DS} = \frac{W}{L} \frac{\mu C_{ox}}{2\alpha} \left[V_{GS} - \dot{V_T} (V_{DS}) \right]^2 \qquad V_{DS} > V_{DS}'$$

 g_{sd} は、以下の如くになる。

$$g_{sd} = \frac{W}{L} \frac{\mu C_{ox}}{\alpha} \left[V_{GS} - \dot{V}_T (V_{DS}) \right] \left(-\frac{\partial \dot{V}_T}{\partial V_{DS}} \right) = g_m \left(-\frac{\partial \dot{V}_T}{\partial V_{DS}} \right) \qquad V_{DS} > V_{DS}$$

これから g_{sd}/g_m は、以下の如くになる。

ソース・ドレイン・コンダクタンス5(強反転)

ΔVπが以下の場合(擬似2次元解析)

$$\Delta V_{TL} \approx -[3(\phi_{bi} - \phi_0) + V_{DS}]e^{-L/\lambda} \qquad \text{(BU, } \lambda = \sqrt{\frac{\varepsilon_s t_{ox} d_B}{\varepsilon_{ox} \beta_3}}$$

 g_{sd}/g_m は、以下の如くになる。

飽和領域の $g_m \ge g_{so}$ の関係



 $g_{m'}, g_{mb'}, g_{sd}$ vs. V_{DS}



基板・ドレイン・コンダクタンス

 $g_{bg}: V_{GS}$ が上昇するにつれ正から負に変わる。 通常動作では、 g_m よりかなり小さく無視できる。 $g_{bs}:$ 通常動作では、無視できる。



となる。

出力コンダクタンス



出カコンダクタンス(基板抵抗がある場合)





 $g_{bd} = \frac{\partial I_{DB}}{\partial V_{DB_{eff}}}$

$$\frac{\partial V_{SB_{eff}}}{\partial V_{DS}} = \frac{\partial (V_{SB} - R_{be} I_{DB})}{\partial V_{DS}} = -R_{be} \frac{\partial I_{DB}}{\partial V_{DS}} = -R_{be} \frac{\partial I_{DB}}{\partial V_{DB}} \cong -R_{be} g_{bd}, \quad \frac{\partial V_{DB_{eff}}}{\partial V_{DS}} \cong R_{be} g_{bd}, \quad \frac{\partial V_{DB}}{\partial V_{DS}} \cong R_{bb} g_{bd},$$

出力コンダクタンスg。vs. V_{DS}



弱反転領域のコンダクタンス1

弱反転領域でのgmは、

$$I'_{M} = \mu \frac{\sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}}}{2\sqrt{2\phi_{F}} + V'_{SB}} \phi_{t}^{2}$$

$$V_{M} = V_{FB} + 2\phi_{F} + \gamma \sqrt{2\phi_{F}} + V'_{SB}$$

$$n = 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_{F}} + V'_{SB}}$$

26

弱反転領域のコンダクタンス2

 g_{mb}/g_{m} は、以下の如くになる。 $\frac{g_{mb}}{g_{m}} \approx n - 1 = \frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_{F} + V_{SB}}} \approx \frac{\varepsilon_{s}}{\varepsilon_{ox}} \frac{t_{ox}}{d_{B}}$

これは、強反転の場合と同じである。また、g_{sd}は以下の如くになる。

$$g_{sd} = \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{DS}} \bigg|_{V_{GS}, V_{BS}} = \frac{e^{-V_{DS}/\phi_t}}{1 - e^{-V_{DS}/\phi_t}} \frac{I_{DS}}{\phi_t}$$

 V_{DS} が大きい場合、

$$g_{sd} = \frac{I_{DS}}{V_{AW}}, \quad V_{DS} > 5\phi_t$$

となる。 V_{AW} は、強反転の場合の V_A より通常は小さい。

全領域(弱~強反転)でI_{DS}は、

$$I_{DS} = \frac{W}{L} \int_{V_{SB}}^{V_{DB}} \mu \left(-Q_{I}\right) dV$$

であるから、g_{sd}は、以下の如くになる。

g。の飽和領域での具体形を求める。 簡単化されたチャージ・シート・モデルからの式 $I_{DS} = \frac{W}{L} \mu \left| \frac{1}{2nC'} \left(Q_{I0}^{'2} - Q_{IL}^{'2} \right) + \phi_t \left(Q_{IL}^{'} - Q_{I0}^{'} \right) \right|$ を用いる。飽和領域で、 $Q'_{\mu} = 0$ とおき、 Q'_{μ} を求める。 $Q_{I0}^{'} = nC_{ox}^{'}\phi_{t}\left(1 - \sqrt{1 + \frac{2L}{\mu W (nC_{ox}^{'}\phi_{t})^{2}} nC_{ox}^{'}I_{DS}}\right) = -\frac{2LI_{DS}}{\mu W \phi_{t}}\frac{1}{1 + \sqrt{1 + \frac{2L}{\mu W nC_{ox}^{'}\phi_{t}^{2}}} I_{DS}}$ $g_{ss} = \mu \frac{W}{L} \left(-Q_{I0}^{'} \right) = \frac{I_{DS}}{\phi_t} \frac{2}{1 + \sqrt{4 \frac{I_{DS}}{I} + 1}}, \qquad \text{(BU, } I_Z = \frac{W}{L} \mu C_{ox}^{'} \left(2n \phi_t^{2} \right)$

 g_m の飽和領域での具体形を求める。 簡単化されたチャージ・シート・モデルからの式 $I_{DS} = \frac{W}{L} \mu \left| \frac{1}{2nC_{I0}} \left(Q_{I0}^{'2} - Q_{IL}^{'2} \right) + \phi_t \left(Q_{IL}^{'} - Q_{I0}^{'} \right) \right|$ を用いる。飽和領域で、 $Q'_{\mu} = 0$ とおくと、 g_{μ} は $g_{m} = \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{CS}} = \frac{W}{L} \mu \left(\frac{Q_{I0}}{nC_{m}} - \phi_{t} \right) \frac{\partial Q_{I0}}{\partial V_{CS}} \approx \frac{W}{L} \mu \frac{Q_{I0}}{nC_{m}} \left(-C_{ox} \right) = \frac{W}{L} \mu \frac{\left(-Q_{I0} \right)}{n} = \frac{g_{ss}}{n}$ $(\underline{\exists} \ \underline{\cup}, \ Q_{I0} = -C_{ox} (V_{GB} - V_{FB} - \psi_{s0} - \gamma \sqrt{\psi_{s0}}), \quad g_{ss} = \mu \frac{W}{I} (-Q_{I0})$

 g_{mb} の飽和領域での具体形を求める。 飽和領域では、g_{sd}はg_mやg_mに比べ小さく無視できる。 (但し、長チャネルデバイスの場合)したがって、 $g_m + g_{mb} \approx g_{ss}, \quad (g_{ss} = g_m + g_{mb} + g_{sd})$ となる。また、 $g_m \approx \frac{g_{ss}}{\sigma}$ であるから、 $g_{mb} \approx \frac{n-1}{n} g_{ss}$ となる。

最大値で規格化された g_{ss} と g_{m} vs. 規格化された $I_{DS}(I_{DS}/I_{Z})$



A. I. A. Cunha, et. al., "A Current-Based Model for the MOS transistor," Proceedings 1997 International Symposium in Circuit and Systems, pp.1608-1611, Hong Kong, June 1997.

小信号 g_m, g_{mb}, g_{sd} の V_{GS} 依存性



中間周波小信号による容量モデル(ソース側: C_{gs} , C_{bs})



ゲート~ソース容量の意味



ゲート電荷の変化は、 $\Delta Q_G = -C_{gs} \Delta V_S$ であるから、 $\begin{bmatrix} -C_{gs}\Delta V_{s} & C_{gs} = -\Delta Q_{G}/\Delta V_{s} \\ \end{bmatrix} + C_{gs}\Delta V_{s} & 2 c_{s} \otimes \partial Q_{s} \end{bmatrix}$ $C_{gs} = -\frac{\partial Q_G}{\partial V_S} \bigg|_{V_G, V_D, V_B}$ となる。

中間周波小信号による容量モデル(ドレイン側: C_{gd} , C_{bd})


中間周波小信号による容量モデル(基板側: C_{ab})



MOSトランジスタ小信号等価回路(簡易版)



38

強反転での各容量計算(条件)

強反転電流式:簡単化されたソース参照モデル

$$Q_{B} \geq Q_{G} \mathcal{O} \mathcal{B} \mathcal{B}$$

$$Q_{B} = -WLC_{ox}^{'} \left[\gamma \sqrt{\phi_{0} + V_{SB}} + \frac{\alpha - 1}{\alpha} (V_{GS} - V_{T}) \left(1 - \frac{2}{3} \frac{1 + \eta + \eta^{2}}{1 + \eta} \right) \right]$$

$$Q_{G} = WLC_{ox}^{'} \left[\frac{V_{GS} - V_{T}}{\alpha} \left(\alpha - 1 + \frac{2}{3} \frac{1 + \eta + \eta^{2}}{1 + \eta} \right) + \gamma \sqrt{\phi_{0} + V_{SB}} \right] - Q_{o}$$

仮定1:
$$\alpha \Rightarrow \alpha_1 = 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{\phi_0 + V_{SB}}} = 1 + \frac{dV_T}{dV_{SB}}$$

仮定2: $\alpha_1 \circ V_s \geq V_B \circ \otimes V_b \circ \otimes$

強反転領域での容量計算(*C_{bs}*の導出)



強反転領域での容量 C_{bs}

したがって、
$$C_{bs}$$
は以下の如くなる。
 $C_{bs} = (\alpha_1 - 1)C_{ox} \frac{2(1 + 2\eta)}{3(1 + \eta)^2} = (\alpha_1 - 1)C_{gs}$
ここで、
 $(\alpha_1 - 1)C_{ox} = \frac{\gamma}{2\sqrt{\phi_0 + V_{SB}}} C_{ox}^{'}WL = \frac{\sqrt{2q\varepsilon_s N_A}}{2\sqrt{\phi_0 + V_{SB}}} WL$
 $= C_{bc}^{'}(V_{SB})WL$ $(C_{bc}^{'}$ は、チャネル〜基板間容量)

したがって、以下の関係がある。

$$\frac{C_{bs}}{C_{gs}} \approx \frac{C_{bc}(V_{SB})}{C_{ox}} = \frac{dV_T}{dV_{SB}} = \alpha_1 - 1 \qquad (V_{SB}$$
が大きく、 V_{DS} が小さい場合)

41



強反転領域での各容量の関係



強反転領域での容量の精度

 $C_{gs} \geq C_{gd}$ は全ての V_{DS} で精度は良い。 C_{bs} 、 C_{bd} 、 C_{gb} は $V_{DS} = 0$ で正確である。 $(V_{GS} \geq V_{DS}$ が大きく、 V_{SB} が小さい場合精度が良くない。) C_{bs} 、 C_{bd} 、 C_{gb} に関しもっと精度を要求する場合、 α_1 を以下の α_5 に変える。

$$\alpha_{5} = 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{\phi_{0} + V_{SB} + k_{c}V_{DS}(1 - \alpha)}}$$

$$C_{gb} \mathcal{O}$$
場合: $k_{c} = 1, \quad C_{bs} \geq C_{bd} \mathcal{O}$ 場合: $k_{c} = 0.1 \sim 0.2$

小信号容量 vs. V_{DS} (V_{SB}=0)



小信号容量 vs. V_{DS} (V_{SB}=2V)



非飽和及び飽和領域での各容量

非飽和領域での容量: $\eta = 1, V_{DS} = 0$ $C_{gs} = C_{gd} = \frac{C_{ox}}{2}$ f^* $C_{bs} = C_{bd} = (\alpha_1 - 1)\frac{C_{ox}}{2} = \frac{1}{2}C_{bc}^{'}(V_{SB})WL$ 基本 $C_{gb} = 0$ (反転層のシールト)による) f^* 飽和領域での容量: $\eta = 0, V_{DS} > V_{DS}^{'}$

ゲート側容量
基板側容量
ゲート~基板間容量

 $C_{gs} = \frac{2}{3}C_{ox}$ $C_{bs} = \frac{2}{3}(\alpha_{1}-1)C_{ox}$ $\int \mathbf{y} - \mathbf{\lambda} \| \mathbf{P} \| \mathbf{P} \|$ $C_{gd} = C_{bd} = 0$ $F \mathbf{V} \mathbf{I} \mathbf{V} \| \mathbf{P} \|$ $C_{gb} = \frac{\alpha_{1}-1}{3\alpha_{1}}C_{ox}$ $f' - \mathbf{V} \sim \mathbf{E} \| \mathbf{P} \|$

ゲートへの小信号印加等価回路



真性トランジション周波数

・ 短絡回路電流利得 |小信号ドレイン電流|/|小信号ゲート電流| $a_i = \frac{g_m}{\omega(C_{gs} + C_{gb})}$

・真性トランジション周波数(カットオフ周波数): $a_i = 1$

$$\omega_{Ti} = \frac{g_m}{C_{gs} + C_{gb}} \approx \frac{g_m}{C_{gs}} = \frac{3}{2} \frac{\mu (V_{GS} - V_T)}{\alpha L^2} = \frac{3}{2} \omega_0 \qquad \qquad \omega_0 = \frac{\mu (V_{GS} - V_T)}{\alpha L^2}$$

飽和領域(強反転):速度飽和のない場合

弱反転、空乏及び蓄積領域での容量

波数は

弱反転領域での C_{sb} は

$$Q_G \approx -Q_B - Q_o, \quad Q_B = -WLC_{ox} \gamma \left(-\frac{\gamma}{2} + \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} + V_{GB} - V_{FB}} \right)$$

から、以下の如くになる。

$$C_{gb} = C_{ox} \frac{\gamma}{2\sqrt{\frac{\gamma^2}{4} + V_{GB} - V_{FB}}}$$

また、

$$C_{gd} \approx C_{gs} \approx C_{bd} \approx C_{bs} \approx 0$$

である。弱反転での真性カットオフ周
 $\omega_{Ti} \approx \frac{g_m}{C_{gb}} = \frac{\mu \phi_t}{L^2} \frac{I_{DS}}{I_M}$ $V_{DS} > 5\phi_t$
となる。

空乏領域での C_{gb} は、弱反転領域と同じになり、

$$C_{gb} = C_{ox} \frac{\gamma}{2\sqrt{\frac{\gamma^2}{4} + V_{GB} - V_{FB}}}$$

となる。また、蓄積領域での C_{gb} は、 $C_{gb} \approx C_{ox}$ となる。

MOShランジスタ断面図と上面図



外部要因を取り込んだ小信号モデル



52

ゲート~拡散層間容量



外部要因の容量1

外部要因のゲート容量 C_{gse} と C_{gde} は $C_{gse} = C_{gde} = WC_o'' = W\left(l_{ov}C_{ox}' + \frac{2}{\pi}\varepsilon_{ox}\ln\left(1 + \frac{t_{poly}}{t_{ox}}\right) + C_{top}''\right)$ となる。ここで、 *l*_{av}:オーバーラップ長さ、 t_{poly}:ゲートポリシリコンの厚み C_{ton} :ゲートのトップからの寄与(全体の約10%) である。また、外部要因のゲート〜基板間容量 C_{ghe} は $C_{obe} = 2LC_{ob}$ となる。ここで、C。はチャネルに沿うフリンジ容量である。

外部要因の容量2

ソース~基板間接合容量 C_{bse} ,ドレイン~基板間接合容量 C_{bde} , ウエル~基板間容量 C_{bb} は、以下の如く表される。 $C_{bse} = A_s C'_{js} + l_s C''_{jsf} + W C''_{jsc}$ $C_{bde} = A_D C'_{jd} + l_D C''_{jdf} + W C''_{jdc}$ $C_{bb} = A_W C'_{jW} + l_W C''_{jW}$

 $C_{js}: Y - x \cdot x + \Delta 0 単位面積当りの接合容量$ $A_s: Y - x$ $C_{jd}: F \nu + \chi \cdot x + \Delta 0 単位面積当りの接合容量$ $A_b: F \nu + \chi$ $C_{jsf}: Y - x + \chi = 0$ $A_b: F \nu + \chi$ $C_{jsf}: Y - x + \chi = 0$ $A_b: F \nu + \chi$ $C_{jsc}: Y - x + \chi = 0$ $A_b: F \nu + \chi$ $C_{jsc}: Y - x + \chi = 0$ $A_b: F \nu + \chi$ $C_{jdf}: F \nu + \chi + \chi = 0$ $A_b: F \nu + \chi$ $C_{jdf}: F \nu + \chi + \chi = 0$ $A_b: F \nu + \chi$ $C_{jdc}: F \nu + \chi + \chi = 0$ $A_b: F \nu + \chi$ $C_{jdc}: F \nu + \chi + \chi = 0$ $A_b: F \nu + \chi$ $C_{jdc}: F \nu + \chi + \chi + \chi$ $A_w: \phi = \chi$ $C_{jdc}: F \nu + \chi + \chi + \chi$ $A_w: \phi = \chi$ $C_{jdc}: F \nu + \chi + \chi + \chi$ $A_w: \phi = \chi$ $C_{jw}: \phi = \chi + \chi + \chi$ $A_w: \phi = \chi$ $C_{jw}: \phi = \chi + \chi + \chi$ $A_w: \phi = \chi$

C_{iw}:ウエル側壁の単位長さ当りの容量

 $A_s: ソース・ボトム面積$ $A_p: ドレイン・ボトム面積$ $l_s: ソース外側全長$ $l_p: ドレイン外側全長$ W: チャネル幅 $A_w: ウエル・ボトム面積$ $l_w: ウエル・サイド・ウォール長さ$

MOSトランジスタ小信号等価回路 (外部容量と抵抗を含む)



ノイズを含むドレイン電流



 $i_{DS}(t) = I_{DS} + i_n(t)$ I_{DS} :理想バイアス電流 $i_n(t)$:ノイズ電流(平均ゼロ)

ノイズ抵抗



58

パワー・スペクトル密度

電流ノイズのパワー・スペクトル密度 $S_i(f)$

⇒ $S_i(f) = i_n^2 / N \vee F = (A^2 / H_z)$ (N \vert F = → 0) 電圧ノイズのパワー・スペクトル密度 $S_v(f)$

⇒ $S_{v}(f) = v_{n}^{2} / N \vee F = (V^{2} / H_{z})$ (N ∨ F = → 0) 電流・電圧の自乗平均は以下で表される。



 $i_n^2 = \int_{f_1}^{f_2} S_i(f) df, \quad v_n^2 = \int_{f_1}^{f_2} S_v(f) df$ ここで、バンド幅は、 $f_1 \sim f_2$ である。サーマル・ノイズ(ホワイト・ノイズ)の場合、 $S_{vt} = 4kTR, \quad S_{it} = 4kT\frac{1}{R}$ となる。このノイズは、Johnson noise またはNyquist noise と呼ばれる。 これは、キャリアの熱によるランダムな動きによる。

ドレイン・ノイズ、電流パワー・スヘックトル密度vs.周波数



ホワイト・ノイズ

強反転領域で速度飽和がない場合、ドレイン電流は、

$$\begin{split} I_{DS} &= -\mu W Q_{I}^{'} (V_{CB}(x)) \frac{dV_{CB}(x)}{dx} \\ \\ & \varepsilon_{AS} \otimes \varepsilon_{AS} \otimes \varepsilon_{AS} \otimes \varepsilon_{AS} \otimes \varepsilon_{SS} \otimes$$

チャネルの微小要素が ΔR の抵抗として振舞うと仮定すると、パワー・スペクトル密度 $4kT\Delta R$ を持つ微小ノイズ電圧 Δv_t を観測でき、バンド幅Bを持つ Δv_t の自乗平均値は、以下で表される。

$$\overline{(\Delta v_t)^2} = 4kT\Delta RB = \frac{4kT\Delta x}{-\mu WQ_I(V_{CB}(x_1))}B$$

チャネル内での仮想電圧△v



チャネル内での仮想電圧△v(回路表現)



チャネル内に△vがある場合の電流式(1)

チャネル内に仮想電圧Δνが存在する場合の電流は、

$$\begin{split} I_{DS} + \Delta i &= -\frac{W}{x_{1}} \mu \int_{V_{SB}}^{V_{1}} Q_{I}^{'} (V_{CB}(x)) dV_{CB}(x) \\ I_{DS} + \Delta i &= -\frac{W}{L - x_{1}} \mu \int_{V_{1} + \Delta v}^{V_{DB}} Q_{I}^{'} (V_{CB}(x)) dV_{CB}(x) \\ \geq & \forall z \, \Im_{\circ} x_{1} \& \ddot{n} \\ \pm & \forall z \, \Im_{\circ} x_{1} \& \ddot{n} \\ = -\frac{W}{L} \mu \left(\int_{V_{1} + \Delta v}^{V_{DB}} + \int_{V_{SB}}^{V_{1}} \right) \\ &= -\frac{W}{L} \mu \int_{V_{SB}}^{V_{DB}} Q_{I}^{'} (V_{CB}(x)) dV_{CB}(x) + \frac{W}{L} \mu \int_{V_{1}}^{V_{1} + \Delta v} Q_{I}^{'} (V_{CB}(x)) dV_{CB}(x) \\ &= -\frac{W}{L} \mu \int_{V_{SB}}^{V_{DB}} Q_{I}^{'} (V_{CB}(x)) dV_{CB}(x) + \frac{W}{L} \mu Q_{I}^{'} (V_{CB}(x)) dV_{CB}(x) \\ &= -\frac{W}{L} \mu \int_{V_{SB}}^{V_{DB}} Q_{I}^{'} (V_{CB}(x)) dV_{CB}(x) + \frac{W}{L} \mu Q_{I}^{'} (V_{CB}(x_{1})) \Delta v \end{split}$$

チャネル内に△vがある場合の電流式(2)

前式の第一項は Δv が存在しない場合の電流 I_{DS} であり、第二項が Δi に当り、以下で表される。

 $\Delta i = \frac{W}{L} \mu Q_I' (V_{CB}(x_1)) \Delta v$

上式はΔνをdcと見なしたが、Quasi-staticな状態でも成立つ。ここで、 x₁を中心とするチャネル内の微小要素を横切って発生するサーマル・ノイズ 電圧を考える。バンド幅Bを持つ全サーマル・ノイズ電圧の一部分をΔν_tとす ると、それに対応するドレイン電流変化Δi_tは、上式の類推から

$$\Delta i_t(t) = \frac{W}{L} \mu Q'_I (V_{CB}(x_1)) \Delta v_t(t)$$

となる。 $\Delta i_t(t)$ の自乗平均値は、以下で表される。

$$\overline{(\Delta i_t)^2} = \left[\frac{W}{L}\mu Q_I'(V_{CB}(x_1))\right]^2 \overline{(\Delta v_t(t))^2} = -4kT \frac{\mu}{L^2} W Q_I'(V_{CB}(x_1)) \Delta x \cdot B, \quad \because \overline{(\Delta v_t)^2} = \frac{4kT\Delta x}{-\mu W Q_I'(V_{CB}(x_1))} B$$

ホワイト・ノイズ の パワー・ス ペ クトル密度(1)

 $(\Delta i_t)^2$ は、 x_i におけるドレイン電流ノイズへの寄与分となる。ここで、 Δx を微分量に変えて、 $\overline{(\Delta i_t)^2}$ の式をチャネル長に渡って積分すると、以下になる。

$$\overline{i_t^2} = -4kT \frac{\mu}{L^2} \left(\int_0^L Q_I W dx \right) B$$

これはバンド幅Bにおける全ノイズ電流の自乗平均値を表す。上記積分が、全反転層電荷Q_I を表すことを考慮すると、ホワイト・ノイズのパワー・スペクトル密度S_{iw}は、以下となる。

$$S_{iw} = 4kT \frac{\mu}{L^2} \left(-Q_I\right)$$

ここで、準定常状態での強反転モデルの Q_I を用いると、 S_{iw} は、

$$S_{iw} = 4kT \left[\frac{W}{L} \mu C_{ox} (V_{GS} - V_T) \frac{2}{3} \frac{1 + \eta + \eta^2}{1 + \eta} \right]$$

となる。

ホワイト・ノイズ の パワー・ス ペ クトル密度(2)

非飽和の場合、 $\eta = 1, (V_{DS} = 0)$ であるから、 S_{iw} は以下となる。

$$S_{iw} = 4kT \left[\frac{W}{L} \mu C_{ox} (V_{GS} - V_T) \right], \qquad V_{DS} = 0$$

一方、小信号ソース・ドレイン・コンダクタンスg_{sd}が以下となるので、

$$g_{sd} = \frac{W}{L} \mu C_{ox} (V_{GS} - V_T - \alpha V_{DS}), \quad V_{DS} \leq V_{DS}$$



等価入力ノイズ電圧のパワー・スペクトル密度

等価入力ノイズ電圧 v_{n,eq}

⇒ノイズ電流の修正量を生じさせるために、仮想ノイズレス・

トランジスタのゲートとソース間に必要とされるノイズ電圧

$$i_t = g_m v_{n,eq} \implies i_t^2 = g_m^2 v_{n,eq}^2$$

この関係から、等価入力ノイズ電圧のパワー・スペクトル密度S_wは、以下となる。

$$S_{vw} = \frac{S_{iw}}{g_m^2}$$
 (注) $g_m = 0$, $(V_{DS} = 0)$, しかし、 $S_{vw}g_m^2$ は有限

等価入力ノイズ抵抗

⇒サーマル・パワー・スペクトル密度が S_{vw} であるような仮想抵抗 $S_{vw} = 4kTR_n$ (注) $R_n = \infty$, $(V_{DS} = 0)$

弱反転領域におけるパワー・スペクトル密度(1)

弱反転領域でも以下の関係が成立する。

$$\begin{split} S_{iw} &= 4kT \frac{\mu}{L^{2}} (-Q_{I}) \\ \Xi \Xi \mathfrak{C}, \quad Q_{I} \& U \ T \ \mathfrak{C} \ \mathfrak{F} \ \mathfrak{F$$

V

(

弱反転領域におけるパワー・スペクトル密度(2)

 S_{iw} は、 $2qI_{DS}$ ($V_{DS} > 5\phi_i$)になる。 上記はサーマル・ノイズを仮定して導出されたが、これはショット・ ノイズから導出されるものと同じになる。

ショット・ノイズのパワー・スペクトル密度: 2qI (I:dc電流)

また、弱反転領域での、等価入力ノイズ電圧、等価入力ノイズ抵抗は、 強反転領域と同様に定義できる。

ショット・ノイズとは

⇒キャリアがポテンシャル·バリア (ソースからチャネル)

を横切ることによって引き起こされる。

⇒到達電荷のディスクリート性による。

フリッカー・ノイズ(1)

[I] Si-SiO,近傍のトラップによるキャリアのトラップ/デトラップ

⇒表面ポテンシャルの変動, チャネル内キャリアのランダムな変動(キャリア数変動) (1)周波数依存性

⇒パワー・スペクトル密度 $\propto 1/f^c$, $c:0.7 \sim 1.2(n - \mathcal{F} + \mathcal{F} + \mathcal{F})$ (2)界面電荷 Q_0' によるフラット・バンド電圧への寄与分 Q_0'/C_{or}'

⇒ゲートに直列なノイズ電圧に等価であり、 $1/C'_{ox}$ に比例,ノイズの自乗平均値 $\propto (1/C'_{ox})^2$ (3)ゲート面積依存性

⇒より大きなゲート面積WL⇒変動をより平均化

 $S_{vf}(f) = \frac{K_1}{C_{ox}^{'2}} \frac{1}{WL} \frac{1}{f^c}, \quad K_1: バイアス依存なし、プロセス依存有り$ $S_{if}(f) = g_m^2 S_{vf}(f)$

フリッカー・ノイズ(2)

[Ⅱ] キャリアと格子との相互作用の変動による移動度変動
 ⇒等価入力ノイズ電圧のパワースペクトル密度は、以下になる。

 $S_{vf}(f) = \frac{K(V_{GS})}{C_{ox}} \frac{1}{WL} \frac{1}{f}$

 $K(V_{GS})$ はゲート電圧依存性を持つ。 C_{ox} の逆比例関係は、ユニバーサルに受入れられない。

前記[I]と[II]は、全ての反転領域で作用しており、どちらかが主となる。 ① n チャネルデバイス

⇒キャリア数変動が主: $K_1 = 5 \times 10^{-31} \sim 1 \times 10^{-30} \text{ C}^2 \cdot \text{cm}^{-2}$ ② p チャネルデバイス

⇒移動度変動が主: $K(V_{GS}) = 6 \times 10^{-26} \sim 2 \times 10^{-23} V^2$, $|V_{GS} - V_T| \approx 1V$ 強反転領域では、 $K(V_{GS})$ は $|V_{GS} - V_T|$ に対し、ほぼ線型で増大する。 弱反転領域では、 $K(V_{GS})$ は $|V_{GS}|$ の減少と共に増大する。
スモール・ディメンジョン効果

- 速度飽和/ホット・キャリア
 - ・ 等価キャリア温度>格子温度⇒サーマル・ノイス[・]増加
- ホット・キャリア
 - 基板電流発生
 - ・ 低基板電流⇒ショット・ノイズ発生
 - ・ 高基板電流⇒基板電位変動によるドレイン電流ノイズ(gmb)発生
 - ・界面準位/酸化膜中トラップ発生(ドレイン近傍)
 - 線型領域でフリッカー・ノイズ増加
- スモール・ケート($WL = 1 \mu m^2$)(但し、ホット・キャリア発生無し)
 - ・界面準位での電荷のトラップ/デトラップの平均化が不十分 ⇒フリッカー・ノイス[・]増加
 - → /ワソカー・/1へ 頃加
 - →極端に小さいケート・デバイスでRTN発生

(RTN: Random Telegraph Noise)

ランダム・テレグラフ・ノイズ



・大きなゲート・デバイスで観測されるフリッカー・ノイズはRTNの重畳されたもの



付録

ゲート・フリンジ容量導出

ゲート・フリンジ容量の導出



$$\frac{1}{r^2} \frac{d^2 \phi}{d\theta^2} = 0 \qquad (\phi: ポテンシャル)$$

*θ*方向の電界

$$\begin{split} \int \frac{1}{r^2} \frac{d^2 \phi}{d\theta^2} r d\theta &= \frac{1}{r} \frac{d\phi}{d\theta} \equiv -E_{\theta} \\ E_{\theta} は \theta &= \pi/2 において次の関係を満たす。 \\ E_{\theta}(r) \Big|_{\theta = \pi/2} &= Q(r)/\varepsilon_{\text{ox}} \end{split}$$

 E_{θ} を積分: $\theta = 0 \rightarrow \theta = \pi/2$ $\int_0^{\pi/2} E_\theta d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{Q(r)}{\varepsilon_{\rm ox}} d\theta$ 左辺= $\int_0^V \frac{1}{r} d\phi = \frac{V}{r}$,右辺= $\frac{\pi Q(r)}{2\varepsilon_{orr}}$ $\therefore Q(r) = \frac{2\varepsilon_{\rm ox}V}{\pi r}$ 全電荷 Q_{tota} は $Q_{total} = \int_0^W \int_t^{t_{poly} + t_{ox}} Q(r) dr dz$ $=\frac{2\varepsilon_{\rm ox}V}{\pi}\int_0^W\int_{t_{\rm ox}}^{t_{\rm poly}+t_{\rm ox}}\frac{1}{r}drdz$ $=\frac{2\varepsilon_{\rm ox}VW}{\pi}\ln\left(1+\frac{t_{\rm poly}}{t}\right)$ 従って、フリンジ容量 C_{of} は、 $C_{of} = \frac{Q_{total}}{V} = \frac{2\varepsilon_{ox}W}{\pi} \ln\left(1 + \frac{t_{poly}}{t}\right)$